

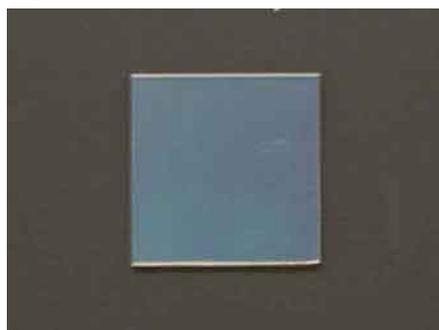
耐ハロゲン性CVDイットリア膜

Halogen resistant CVD Yttria film / Y_2O_3

SHIELD-C2

『SHIELD-C2』はCVD法によって成膜する高純度CVDイットリア (CVD- Y_2O_3) 膜です。反応性が高いハロゲンガスに対して耐食性が向上し、プラズマエッチング・プラズマCVD・プラズマアッシング装置などのパーツの高寿命化にご利用頂けます。

SHILD-C2コート石英ガラス



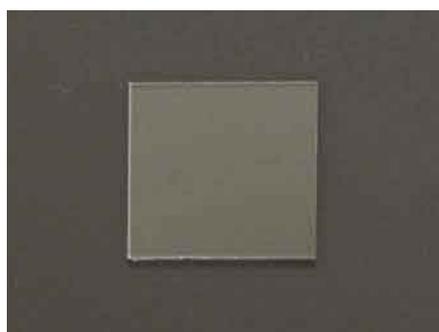
試験前



試験後

耐食性

石英ガラス



試験前



試験後

耐食性 ×

フッ素系ガス耐食試験結果

特長

- わずか $0.1\mu m$ の薄膜で対象物を腐食性ガスからバリアします。
- 薄膜化により低価格で Y_2O_3 膜を提供します。
- 優れた段差被覆性。

T.C.S

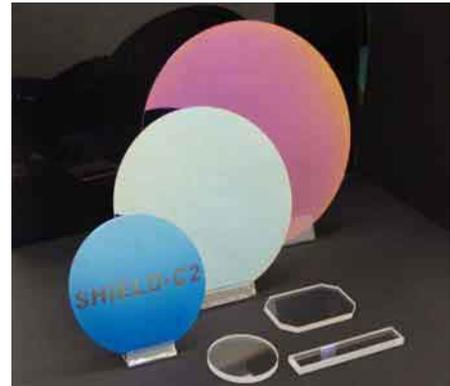
時田CVDシステムズ株式会社
TOKITA CVD SYSTEMS CO., LTD.

用途

● プラズマエッチング、プラズマCVD、プラズマアッシング装置などの真空構成部品の耐食性向上

成膜標準仕様

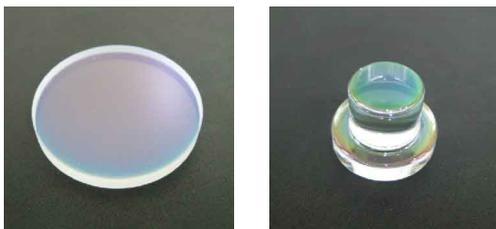
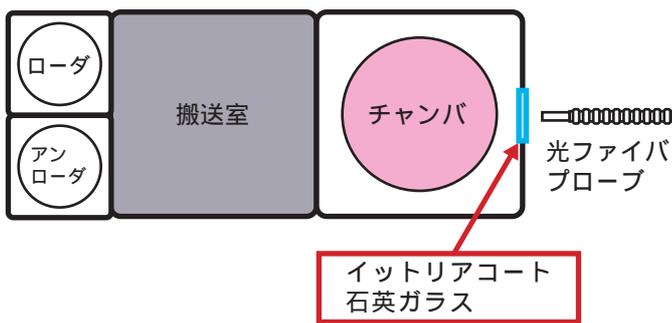
基材材質	石英ガラス、シリコン、セラミックス
最大処理サイズ	500 x H200
膜厚	0.2μ m
イットリア膜不純物濃度	重金属、アルカリ金属 < 0.5ppm



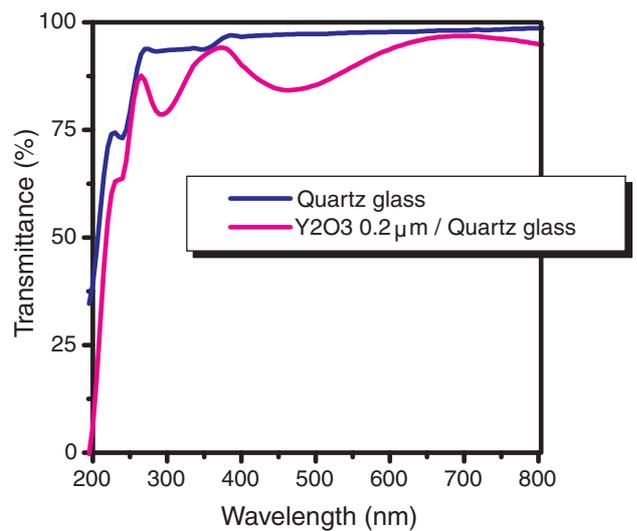
イットリアコーティング例

納入実績

エッチング装置のエッチング終点モニター窓、覗き窓にご使用頂き、高い耐食性能が得られています。20倍以上のライフタイムが確認された導入事例もございます。わずか0.1μ mの薄膜にすることにより紫外・可視領域で80%以上の透過率が得られます。



納入実績例



UV-Vis透過スペクトル